

Dr.-Ing. Patrick Hofstetter "Hochausnutzung von Siliziumkarbid-Feldeffekttransistoren in Traktionsumrichtern" Promotionsprüfung am 20.05.2020







- hohe kritische Feldstärke
- Basis SiC Bauelement deutlich d
 ünner
- \rightarrow Unipolare Bauelemente z.B. MOSFET bei gleicher Chipfläche 1000-mal niedrigerer Driftzonenwiderstand
- Struktur MOSFET (siehe Abb. 1): Rückwärtsleitfähigkeit direkt durch Bodydiode gewährleistet

SIC MOSFET 2012 Erster öffentlicher Test von SiC-Hybridmodulen im Traktionsumfeld

2017-2019 SiCuM Projekt: Erforschung von SiC MOSFETs in der urbanen Mobilität

Hochausnutzung von SiC MOSFETs in Traktionsumrichtern: Erforschung der Robustheit und des Schaltverhaltens von SiC MOSFETs im Traktionsumrichter und dazu passender Schutz- und Ansteuermethoden

Abb. 1: Trench-MOSFET Struktur und Schaltsymbol

Schaltcharakterisierung in den Umgebungsbedingungen vom Traktionsumrichter

- Doppelpulsexperiment:
 - Einzelchips \rightarrow Zwischenkreisinduktivität L_{σ} auf das selbe $L_{\sigma} \cdot I_{d,n}$ skaliert wie bei Applikation
 - Auslegung Gatewiderstände
 - maximale Zwischenkreisspannung $V_{\rm ZK} = 1200 \text{V}$ und 1700 V SiC MOSFETs
 - \rightarrow Auslegung in Grenzfallbedingungen folgend immer auf 500V Überspannung!

Sic MOSFET Simulationsmodell



Aufbau und Parametrierung

- Aufbau (siehe Abb. 2):
- Reduktion auf die Elemente, welche das Schaltverhalten maßgeblich bestimmen
- ideale Diode als Bodydiode
- Einfache Parametrierung:
 - Passive Elemente
 - Common-Source-Elemente (cs) aus Kurzschlussmessung bestimmt
 - Rest aus Datenblatt
 - Spannungsabhängige Kapazitäten
 - aus Datenblatt

Optimierung des Schaltverhaltens

Ziel der Optimierung:

Verbesserung des Trade-offs zwischen Ausschaltoszillation und Schaltverlusten



Ausschaltvorgang

- Parameteranalyse im halbphysikalischen Modell zeigt enorme Vorteile von niedrigem C_{gd}/C_{gs} -Verhältnis
 - \rightarrow Optimierter SiC MOSFET zeigt deutlich weniger **Oszillation und niedrigere Verluste (siehe Abb. 4)**
- Optimierung durch externe Maßnahmen
 - Erhöhung der Common-Source-Induktivität durch Ansteuerung an den Lastanschlüssen des Source

- Unipolares Bauelement
 - keine Schleusenspannung
 - kein Tailstrom beim Schalten

 $f_{\rm ch}(v_{\rm gs}, v_{\rm ds}) = \max((\min(i_{\rm d,act}(v_{\rm ds}), i_{\rm d,sat}(v_{\rm gs}, v_{\rm ds})), 0))$ $i_{\rm d,act}(v_{\rm ds}) = rac{v_{\rm ds}}{R_{\rm ds,or}}$ $i_{d,sat}(v_{gs}, v_{ds}) = \frac{\kappa}{2} \cdot (v_{gs} - V_{th} \cdot (1 - \alpha_1 \cdot v_{ds}))^M \cdot (1 + \alpha_2 \cdot v_{ds})$

Abb. 2: Aufbau des Simulationsmodells

Performance des Modells

- Einfache Parametrierung mit Datenblatt und einzelnen Messungen
- kein Modell des Herstellers nötig
- Repräsentation der Schaltvorgänge sehr gut
- Einschaltvorgang: Bei hohen Temperaturen keine bipolare Vorgänge der Bodydiode implementiert
- Ausschaltvorgang immer gut repräsentiert
- \rightarrow Für Optimierung des Ausschaltens ideal



Abb. 3: Transferkennlinen (orange) und gefittetes $i_{d,sat}(v_{gs}, v_{ds})$

Abb. 4: Vergleich zwischen Ausschaltmessung des alten (gestrichelt) und des neuen SiCuM-MOSFETs (durchgezogen) mit gesenkter C_{gd}-Kapazität

Einschaltvorgang

- Begrenzend ist Ausschaltvorgang der Bodydiode durch Reverse-Recovery und damit verbundener Überspannung
- Totzeitoptimierung kann Bodydiode entlasten, sodass Schaltvorgang beschleunigt werden kann
- Ausnutzen parasitäres Wiederaufsteuern (PTO)
- bei dem DUT führt leichtes PTO zu deutlich niedrigerer Überspannung (siehe Abb. 5)
- → Durch Beschleunigung ca. 1/10 der Ein-Verluste



Einbringen externes C_{gs} wirkt ebenfalls



PTO (gestrichelt) und ohne PTO (durchgezogen)

 \bigcirc \bigcirc

Kurzschlussschutz von SiC MOSFETs

SiC MOSFET Kurzschlussmessungen zeigen Sättigungsströme über dem 5-fachen Nennstrom und Zerstörungen weit vor 10 μs



Spezieller Kurzschlussschutz nötig

Aufbau des Kurzschlussschutzes

kV

Spannung

_1

- Verwendung der 2D-Detektionsmethode
- prinzipielles Schaltbild (siehe Abb. 6)
- Auslösen des Kurzschlussdetektionssignals (SCDS) bei positiven di/dt und Überschreiten

Stoßstrombelastung an SiC Bodydioden

Nach erfolgreicher Kurzschlussabschaltung kommt es zu Stoßstrombelastungen der SiC Bodydioden

Anforderung im Vergleich zu Siliziumdioden

 $\frac{I_{\text{FSM,SiC}}}{[0,75...1,5] \cdot A_{\text{Si,Diode}}}$ $\frac{I_{\text{FSM,SiC}}}{\underline{\blacksquare}} \stackrel{(6.2.3)}{\underline{\blacksquare}}$ *I*_{FSM,Si,Diode}

Ergebnisse der Messungen

- typischerweise Ausfall durch Schmelzen der Oberseitenmetallisierung $\rightarrow T_{\text{Aluminium}} \approx 660^{\circ}\text{C}$
- Ausfall bei Variation der Temperatur und Pulslänge über eigenes thermisches Modell erklärbar

- normale Einschaltvorgänge werden auch bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen nicht beeinflusst
- KS2 (siehe Abb. 7) und KS1 werden noch weit vor der Sättigung sicher abgeschaltet

des Gatekomparators

- $\overline{2\cdot i_{
 m d1}}$ $-v_{\rm gs} \cdot 50 - - 2 \cdot i_{\rm d2}$ ^^^ Strö 2D-Signale Zeit in μs
- **Abb. 7:** Eingreifen des Kurzschlussschutzes im KS2



mehrfache Stoßstrombelastung zeigt Vorschädigungen erst kurz vor Erreichen des Einfachpuls-Ausfallwertes (SPF-Wert)

